

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 17 年 4 月 28 日 (2005.4.28)

【公開番号】特開 2001-145622 (P2001-145622A)  
 【公開日】平成 13 年 5 月 29 日 (2001.5.29)  
 【出願番号】特願 平 11-332279  
 【国際特許分類第 7 版】

A 6 1 B 6/03

【F I】

A 6 1 B 6/03 3 2 1 Q

A 6 1 B 6/03 3 5 0 F

【手続補正書】  
 【提出日】平成 16 年 6 月 22 日 (2004.6.22)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】特許請求の範囲  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

被検体に照射する X 線を放射するための X 線源と、上記被検体を透過した X 線を投影データとして検出するために上記 X 線源に対向して配置された二次元 X 線検出器と、上記 X 線源と上記二次元 X 線検出器とを搭載して上記被検体の回りを回転するスキャナ部と、上記 X 線源による上記被検体への X 線の照射条件と上記二次元 X 線検出器による上記投影データの計測条件とを記録するための記録手段と、上記記録手段に記録された上記 X 線の照射条件と上記投影データの計測条件とを使用して上記二次元 X 線検出器により計測された上記投影データを補正するための補正手段とを具備してなることを特徴とする X 線断層撮影装置。

【請求項 2】

X 線源と該 X 線源からの X 線を検出する二次元 X 線検出器を搭載したスキャナを用い、該スキャナを被検体の周囲で回転させることにより上記被検体の周囲の複数の投影角方向から上記被検体に上記 X 線を照射して上記被検体の複数の透過 X 線像を投影データとして計測し、この複数の透過 X 線像を用いて上記被検体内の X 線吸収係数の三次元分布像を再構成する X 線断層撮影装置であって、上記の被検体計測時に、上記複数の投影角毎に上記 X 線源による X 線の照射条件と上記二次元 X 線検出器による X 線の計測条件との双方或いはいずれか一方を変化させつつ計測を行なう X 線断層撮影装置であり、上記被検体計測時の上記複数の投影角毎の上記 X 線照射条件および上記 X 線計測条件とを記録するための X 線照射・計測条件記録手段と、該 X 線照射・計測条件記録手段に記録された上記 X 線照射条件及び上記 X 線計測条件とを用いて上記二次元 X 線検出器で計測した上記投影データを各投影角毎に補正する投影データ補正手段とを具備してなることを特徴とする X 線断層撮影装置。

【請求項 3】

X 線源と該 X 線源に対向して配置された二次元 X 線検出器とを被検体の回りで回転させながら上記 X 線源からの X 線を上記被検体に照射して上記被検体を透過した X 線を上記二次元 X 線検出器により投影データとして検出する検出工程と、上記 X 線源による上記被検体への X 線の照射条件と上記二次元 X 線検出器による上記投影データの計測条件とを記録する記録工程と、上記記録工程において記録された上記 X 線の照射条件と上記投影データの計測条件とを使用して上記二次元 X 線検出器により検出された上記投影データを補正す

る補正工程とを含んでなることを特徴とするX線断層撮影方法。